# 表面硬化膜形成用

For forming a surface hardened film

Ideal as a small-quantity production machine / experimental machine.



### 【概 要】

- 1. 蒸発源表面上にアーク放電を発生させ、 溶解・蒸発・イオン化を経て薄膜を形成します。
- 2. TiN、TiAIN硬化膜の成膜が可能となっております。

### [General Outline]

- 1.An arc discharge is generated on the surface of the evaporation source, and a thin film is formed through dissolution, evaporation, and ionization. 2.It is possible to form a TiN and TiAIN cured film.
- 【用途•応用例】

切削工具

自動車・機械部品

各種金型

### [Applications]

Cutting tools

Automobile / Mechanical parts

Various molds

### 【特

- 1. 切削工具等への表面硬化膜(TiN、TiAIN膜)の成膜が可能です。
- 2. 据付面積(操作盤・ポンプユニット・電源含) W3,000mm×D2,500mm内の省スペースです。
- 3. タッチパネル操作による成膜レシピ制御が可能です。
- 4. 少量生産機・実験機として最適です。
- 5. 高融点金属(タングステンやモリブデン)の蒸発も可能です。

### [Features]

- 1.It is possible to form a surface-hardened film (TiN, TiAlN film) on cutting tools.
- 2. The installation area is within W3,000mm x D2,500mm, which saves space.
- 3. Film formation recipe control is possible by touch panel operation.
- 4.Ideal as a small-quantity production machine / experimental machine.
- 5. Evaporation of refractory metals (tungsten or molybdenum) is also possible.

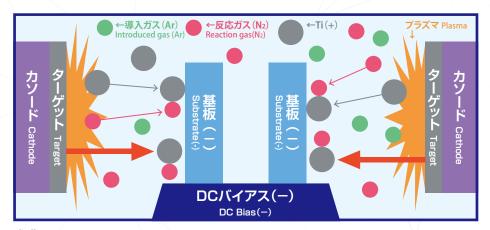
# SIA-400T

# アーク放電型 イオンプレーティング装置

Arc-Discharge-Type Ion Plating Equipment

## 表面硬化膜形成用

For forming a surface hardened film



### 成膜原理

Film formation principle

### 仕 様 Specification 到達圧力 1.2×10<sup>-3</sup>Pa以下 Ultimate Pressure 1.2×10<sup>-3</sup>Pa or less 6.7×10-3Paまで15分以内 排気速度 **Exhaust Speed** Within 15 minutes to 6.7×10-3Pa MAX350°C 基板加熱 MAX350°C Substrate Heating 10kW 蒸発電源 **Evaporative Power Supply** 10kW 基板治具 ①公転治具 MAX Φ200mm×H250mm Revolution iig MAX Φ200mm×H250mm Substrate Jia ②自転治具 MAX Φ70mm×H250mm ×5軸 Rotation jig MAX Φ70mm×H250mm ×5axes 真空槽 約W350mm×D475mm×H400mm、SUS304製 Vacuum Chamber Approx. W350mm×D475mm×H400mm, made of SUS304 据付面積 約W1,600mm×D1,000mm×H1,600mm ①Body approx.W1,600mm×D1,000mm×H1,600mm Installation Area ②操作盤 約W565mm×D820mm×H1,800mm ②Operation panel approx.W565mm×D820mm×H1,800mm ③ポンプ架台 約W400mm×D800mm×H910mm 3Pump stand approx.W400mm $\times$ D800mm $\times$ H910mm



TiN成膜例

TiN film formation example



株式会社昭和真空 SHOWA SHINKU CO., LTD.

ご質問・詳細につきましては、 営業部までお気軽にお問合せください。

### お問合せ先【営業部】

本社•相模原工場

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062-10

TEL. 042-764-0370

FAX. 042-764-0377

E-mail. sales-pamphlet@showashinku.co.jp

https://www.showashinku.co.jp/

昭和真空

検索

### Inquiry [Sales Dep.]

HQ and Sagamihara Plant

3062-10 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-city, Kanagawa 252-0244 Japan TEL:+81-42-764-0370 FAX:+81-42-764-0377

本製品は、外国為替並びに外国貿易管理法の規定により、戦略 物資等輸出規制品に該当する場合があります。従って、日本国 外に該当品を持ち出す際は、日本国政府への輸出許可申請等、 必要な手続きをお取りください。

This product may be applicable to export control products such as strategic raw materials which are regulated by the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Accordingly when you bring out the applicable products outside Japan, you should take a necessary action such as application of an export permit to the Government of Japan

### Web site 製品情報ページ

真空中で特定の基板に薄膜を形成させ る装置を主とした、真空蒸着装置やス パッタリング装置等の真空技術応用装 置(真空装置)を製造販売しております。



https://www.showashinku.co.jp/product/

### 所要諸元 Required Specifications

所要電力 本体 Φ3 200V 約38.3KVA(110.5A) Main body Φ3 200V Approximately 38.3KVA (110.5A) Required Electricity

所要水量 Required Water Volume 0.2MPa以上(差圧)、19L/min、20~25℃

0.2MPa or more (differential pressure), 19L/min, 20-25 °C

※冷却水入口の最大圧は0.4MPa以下、水質は市水相当 \* The maximum pressure at the cooling water inlet is 0.4MPa or less, and the water quality is equivalent to city water.

所要圧空 Required Compressed Air

0.7MPa(設定圧0.5MPa)、接続口径Rc3/4 0.7MPa (set pressure 0.5MPa), connection diameter Rc3/4

ガス圧力

Gas Pressure

0.05MPa(設定圧0.02MPa)、接続口径SWL1/4 0.05MPa (set pressure 0.02MPa), connection diameter SWL1/4

※本仕様・外観については、改良のため予告なく変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。

\* For the improvement of the product, please understand in advance that the specifications and external views are subject to change without prior notice